

中国における早期公開・ 早期登録特許の実態

アジア特許情報研究会

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

日本バルカー工業株式会社

伊藤 徹男
中西 昌弘
吉居 未来



要 約

中国の特許，実用新案，意匠の出願が急激に伸びる中，2012年以降の出願特許のうち，出願から6か月以内に公開となる特許が全出願の約半分を占めるという異常な状況になっている。中国では，これまで「早期公開請求」をして審査を促進させる制度は存在したが，漸く，2012年8月に出願人自らが申請できる「優先審査請求制度」が導入された。早期に公開される特許の急増はその影響であろうか。

本稿では，出願から18か月より前に公開されるこのような特許を「早期公開特許」と位置づけ，出願人や出願分野の動向について解析した。さらに，中国の特許，実用新案は権利維持期間が短いと言われているが，“早期公開特許は早期に権利化を図る点から重要特許が多く，権利維持期間も通常公開特許に比べて長いのではないか”という推察から，法人や個人出願人別の権利維持状況についても解析を加え，考察した。

目次

1. はじめに
2. 中国の特許出願推移と特許制度
3. 早期公開特許および早期登録特許の実態
4. 権利維持の状況
5. おわりに

1. はじめに

ここ数年，中国の特許，実用新案，意匠の出願が急激な伸びを示していることは周知の事実である⁽¹⁾。しかしながら，これら膨大ともいえる出願の多くは登録となっても数年で失効（そのほとんどは維持年金の未納）している事実を見ると⁽²⁾，事業化目的や他社を牽制するための権利化ではなく，出願補助金目当てやハイテク認定による法人税減免目的，研究機関においては研究費獲得のためであるかのようにも見える。

中国特許庁は，権利維持されている特許や実用新案を，「有効発明専利」「有効実用新案専利」と称して毎年統計情報を出している⁽²⁾。また，上記のような権利化目的ではない（出願することだけが目的であるかのような）出願の実態を改善すべく，中国特許庁から昨年末（2013年12月25日）には特許出願の質を向上さ

せるための意見書が出された⁽³⁾。今後はこの意見書に基づき，出願量ではなく出願の質が求められるように修正されるものと思われるが，しばらくは質の低い特許や実用新案がパテントロールやその他の訴訟（係争）に利用されることも懸念される。

したがって，中国の特許や実用新案の凄まじい出願量に一喜一憂するのではなく，権利維持される特許や実用新案を把握して自社権利の実施や係争などに備えることが今後，重要となっている。

本稿では，このような膨大な中国特許において，特に最近の動向として早期に公開される特許や早期に登録される特許が増えつつあるので，これらの特許について解析を加え，重要な監視対象であるのかどうか，その実態を明らかにすることとした。

ここでは，出願から18か月以内に公開される特許を「早期公開特許」，出願から2年以内に登録となる特許を「早期登録特許」と定義して，中国特許出願の一端を考察した。

また，このような早期公開特許（早期登録特許）は，早期に権利化したい，という出願人の意向が強く働いているものと考えられることから出願から18か月後

に公開される通常の公開特許に比べて、権利維持期間が長いと想定される。そこで、早期公開特許における権利維持期間についても考察することとした。

中国においては、実用新案が特許と同様に係争の具として持ち出され重要視されているが、これについては既に多くの論稿があるので割愛し、本稿では特許に焦点を当てて紹介することにする。本稿で用いた出願、公開、登録の数値は、中国知識産権出版社 (IPPH) が運営・管理する「CNIPR」という中国語データベース (中国版および日本版) を用いて取得し、解析した。

2. 中国の特許出願推移と特許制度

(1) 特許出願の推移

図1および図2に2000年以降の特許出願推移を公開年を基準に、それぞれ法人と個人の別、中国内国からの出願か外国からの出願かの別で示した。実用新案の場合には個人の比率が比較的高く、2008年までは個人が法人を上回っている状況であったが、特許においては個人の比率は低い。また、内国・外国の出願状況では2005年までは外国からの出願が内国出願を上回っていたが、2006年以降は内国からの出願が上回るようになった。

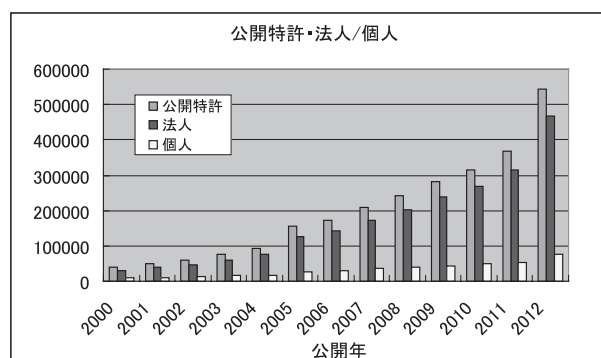


図1 公開特許の出願推移 (法人・個人別)

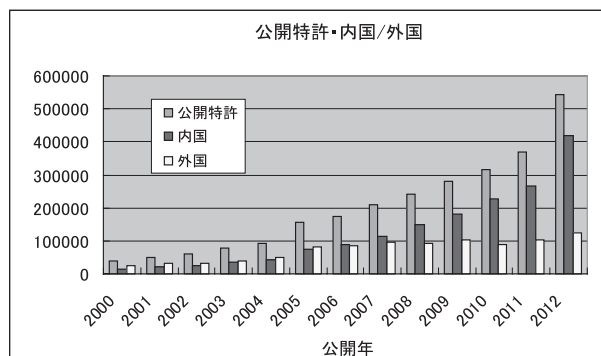


図2 公開特許の出願推移 (内国・外国別)

(2) 中国特許制度の最近の動向

日本や韓国においては、早期審査制度 (優先審査制度) があり、公開前に登録となるケースはめずらしくなくなったが、中国においては、出願され公開された後でないと審査が始まらないため (審査するためには、もちろん審査請求がなされていることが条件となる)、公開前登録特許というものはない。

中国では、これまで「早期公開請求」をして審査を促進させる制度は存在したが、『優先審査請求制度』はなかった。

中国専利法第35条に基づく審査指南には、審査の順序は一般には受け付け順によるが、以下の例外も認められ、優先審査が行われることもあり得ることが定められている⁽⁴⁾。

- ① 国家の利益或いは公共の利益にとって重大な意義をもつ出願
- ② 専利局が自ら実体審査を開始した専利出願
- ③ 原出願日を保留してある分割出願は、原出願と共に審査を行ってもよい

しかし、実務上は本条に基づく優先審査は実質的に行われることはほとんどないとされる。

このような日本や韓国と異なる法制度の下、2012年8月に「優先審査請求制度」が導入され⁽⁵⁾、出願動向にも変化が見られるようになった。「優先審査制度」導入後においても公開された後、審査されて登録となることには変わりなく、公開前に登録となることはない。

中国における審査促進の手段としては、①他国の審査を斟酌して審査する「特許審査ハイウェイ (PPH) の活用」 (中日特許審査ハイウェイは2011年11月に開始)、②中国専利法34条に基づく早期公開請求 (実体審査を数か月程度早めることができる)、さらに、③特定の重要な発明について優先審査請求ができる、として「優先審査請求制度」が加わった。

新たな優先審査請求制度の基では、それが受理されると第1回拒絶理由通知書は30日以内に出され、1年以内に拒絶か登録かの結論が出されることになっており、出願人にとって早期権利化を図る極めて有効な手段となった。但し、「優先審査請求書」は予め中国各省、自治区、直轄市いずれかの知識産権局に申請してコメントを記入してもらう必要がある (発明専利出願

優先審査申立書)、実質的に中国国内在住の出願人または現地法人のみしか利用できない状況となっているようである。

また、拒絶理由通知書に対する応答期間は通常約4か月程度あり延長も認められるが、優先審査請求の場合には2か月以内に応答することが求められ、延長もできない。この期間に遅れた場合には優先審査が中止され、通常審査に戻されるペナルティが課され、この点でも外国からの出願、対応には現地代理人事務所との迅速で緊密なやりとりが求められることになる。

3. 早期公開特許および早期登録特許の実態

(1) 早期公開特許の推移

本稿では、このような制度の下において最近大きな変化が見られる特許公開の状況を紹介する。出願から公開までの期間を6か月ごとに区切って(取得データは1か月単位)公開公報数をプロットしたものを図3に示した。比較データとして日本特許の状況を図4に示した。

日本特許の場合には、ほとんどの公開は出願から19～24か月に公開となっているが、中国においては18か月以前の早期に公開されるものが半分以上あり、2010年以降は出願から6か月以内に公開されるものの比率が次第に高くなっている。特に、2012年出願分では出願から6か月以内に公開されるものは全出願数652777件の45%(294919件)を占めるまでになり、2013年出願分も全出願数825136件の約50%(414672件)に達する異常とも言える状況になっている。なお、全出願数はSIPO年度報告に基づく数字である⁽¹⁾。

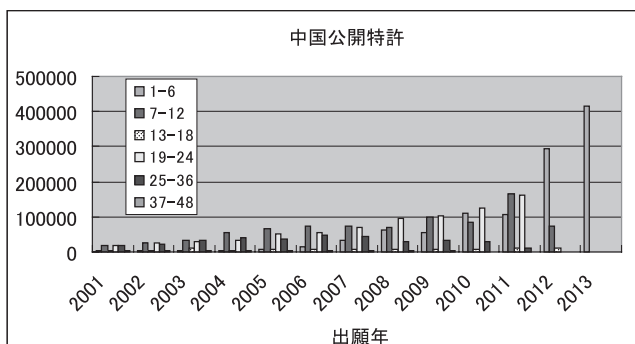


図3 中国早期公開特許の推移

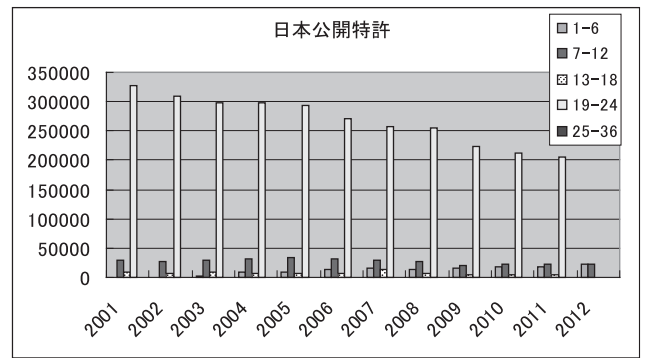


図4 日本早期公開特許の推移

但し、図3、図4の公開特許数は出願日をベースに抽出しているため、2011年以降については今後さらに若干のデータが積み上がることになる。(2013年の出願から6か月以内の公開数は2013年12月に出版されたものの6か月後発行数が2014年5月に確定する)

図3、図4の凡例中の数字は、出願から公開までの月数を示す。

(2) 超早期公開特許の出願人動向

図3における出願から6か月以内に公開された特許(以下、このような特許を「超早期公開特許」という)の2010年以降2013年までの出願人TOP10の動向を図5に示した(ランキング10位が同数なので11出願人となっている)。

企業では、ここ数年、中国特許出願数1、2位を争う中興通讯(ZTE)と華為技術(Huawei)が目立つ他は、大学が多い。国営企業である国家电网(State Grid Corporation of China)は2012年には一挙に2位につけ、2013年には6036件(該社全出願件数6236件の97%)と2位の浙江大学の2281件の2.6倍以上となってトップとなっている。

参考データとして図6に該当11出願人の2010年～2013年の特許出願数の推移を示した。2011年まで公開特許ランキング100位にも入っていなかった国家电网の躍進ぶりが窺えると共に中興通讯は出願数を大きく下げている。従来から中国特許出願のリーディングカンパニーであった中興通讯は2012年に28億元の赤字転落となっているのでこの影響であろうか⁽⁶⁾。

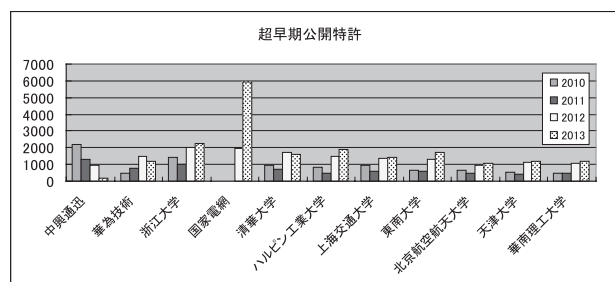


図5 超早期公開特許（出願年基準）

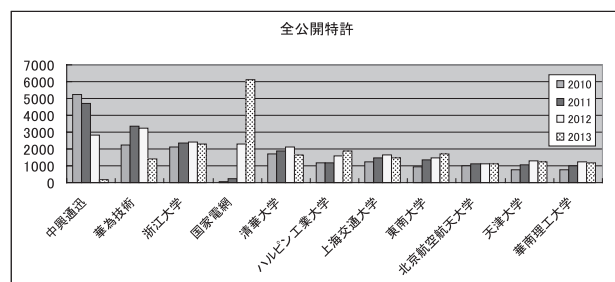


図6 超早期公開特許の出願人ランキングTOP10の出願推移（出願年基準）

（3）超早期公開特許の分野別状況

表1に超早期公開特許の出願分野TOP10を国際特許分類（IPC）のランキングとして示した。医薬関係および情報伝送などの出願が多いことがわかる。

また、図5で抽出した出願人TOP10の出願分野を解析した結果、中興通迅と華為技術は、デジタル情報伝送など通信分野の出願に集中しており（H04L, G06F, H04W）、国営の電力設備企業である国家電網は電氣的試験装置（G01R）や電力配電用の回路（H02J：いわゆるスマートグリッドなど）に特化しており、他の大学の多くもデジタルデータ処理など情報分野の出願が多い。

分野別ランキング上位の医薬品関係（A61K, A61P）の出願人としては、中国人民解放軍の医学科学院や大学病院、中国薬科大学、浙江大学などの研究機関からの出願のほか、李承平、丁圣雨、吴俊华などの個人が2010年以降の4年間でそれぞれ各年100件以上の出願をしている。A61K, A61P全体では約40%を個人出願人が占めていることがわかった。

表1 超早期公開特許のIPCランキング

IPC 分類	分類の概要	出願年			
		2010	2011	2012	2013
A61K	医薬製剤	7,159	8,114	16,292	19,832
A61P	医薬製剤の治療活性	6,549	7,412	14,859	18,061
G06F	デジタルデータ処理	5,742	5,846	12,146	17,080
H04L	デジタル情報伝送	5,022	5,564	9,314	10,217
G01N	材料の分析	3,373	1,876	9,520	11,813
A23L	食品、飲料	2,031	2,326	6,350	8,771
C08L	高分子組成物	2,270	1,197	6,238	7,614
H01L	半導体装置	1,576	2,868	6,116	5,794
C02F	水処理	2,356	1,355	5,278	5,959
C08K	無機・有機添加剤	1,682	996	5,090	6,511

（4）早期登録特許の推移

他方、早期登録特許の状況を図7に示した。中国ではさすがに出願から1年以内に登録となるものはほとんどないが、2010年以降は2年以内に登録になるものが次第に増えている。

図7の凡例中の数字は、出願から登録までの月数を示す。

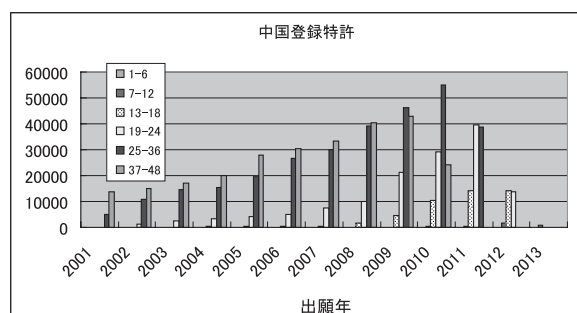


図7 早期登録特許の推移

4. 権利維持の状況

早期公開特許は、早期に権利化したい、という出願人の意向が強く働いているものと考えられることから、出願から18か月後に公開される通常の公開特許に比べて、権利維持期間も長いと推察される。そこで、超早期公開特許と通常公開特許における権利維持期間について比較した。

（1）中国における特許の権利維持状況

まず、中国で出願された特許の権利維持状況全般を見てみよう。

中国特許庁は、出願されてから現在まで権利が存続している特許や実用新案（有効発明専利、有効実用新案専利と称している）について、毎年その維持状況を失効理由と共に報告している⁽²⁾。それによるとその維持期間は、特許では出願から3年～10年（国内出願人では平均4年、外国出願人では平均7、8年）に集中し

ており、10年以上保有されるものは少ない。さらに、実用新案においては、80%が出願から4年以内（平均2年）の維持年数であり、満期まで権利維持されるものは極めて少ない、と報告している（図8）。

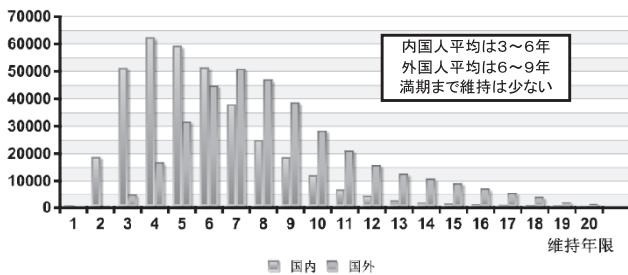


図8 中国特許の維持年限（中国特許庁 専利統計簡報 2013年9期⁽²⁾）

我々は中国特許庁の有効特許、有効実用新案の解析とは異なる観点から別途、中国特許について登録後失効した約2700000件を解析し、権利維持期間を調べた。その結果、出願から2年～5年の維持年数が85%を占め、出願から3年ないし4年が最も多いという中国特許庁と同様の傾向を確認した（図9）。このように中国における特許（実用新案も）の権利維持期間は極めて短いことを再確認できた。

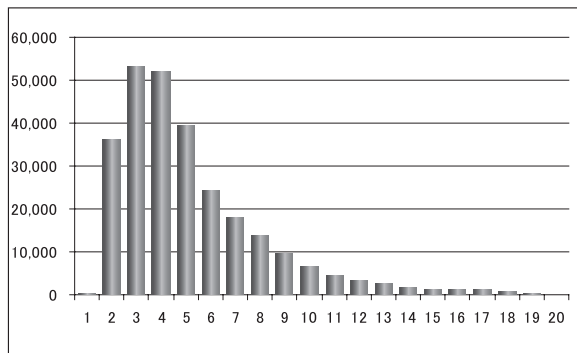


図9 中国特許の権利維持年限（独自調査結果）

（2）早期公開特許の権利維持状況

そこで超早期公開特許と通常公開特許では、出願から権利消滅までの権利維持期間に差が生じるか、について検証した。結果を図10に示す。

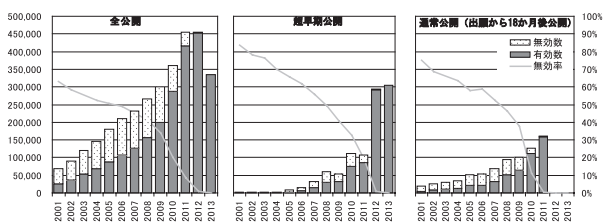


図10 早期公開特許の権利維持状況

出願日を基準にしているために「全公開」の公開数およびすべての項目の無効数は期間の経過と共に増えることに留意する必要がある。

公開数に対する無効数（拒絶理由通知などに未対応で見做し取下げとされたものや年金未納などで失効した特許）を無効率として見てみると超早期公開特許の無効率は、通常公開および全公開のものに比べて低い（権利維持期間が長い）とは言えず、むしろやや高い、という数値を示した。したがって、「早期公開特許は権利的に重要なものが多く、権利維持期間も長い」という推察は成り立たないことが判明した。

（3）早期登録特許の権利維持状況

出願から2年以内に登録になるものを「早期登録特許」と定義して、その権利維持状況を調べ、結果を図11に示した。

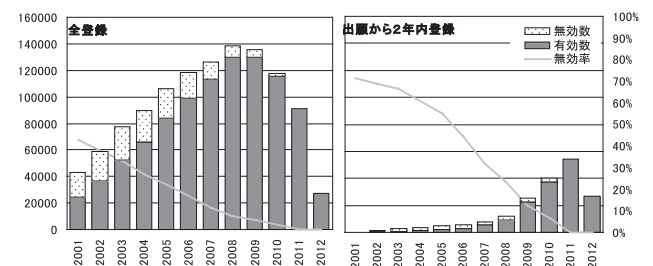


図11 早期登録特許の権利維持状況

早期に成立した登録特許においても登録特許全体に比べ無効率が低いとは言えず、早期公開特許と同様に早期登録特許の方がやや高い無効率を示した。

（補足）

別添表として公開特許数、登録特許数の年単位での発行数を抽出し、別表1および別表2に示した。表中、公開数および登録数が中国特許庁（SIPO）発表の出願数、登録数と合致していないのは、特に2008年以降出願のものは今後（2014年以降）公開あるいは登録されるものを含むためである。つまり、出願から公開までのタイムラグのため取下げや見做し取下げを除き、出願されたすべてが公開されるには10年以上を要することがその理由である。但し、これまでの検討から出願から5年以上経過して公開となるものの多くは分割出願分であることも判明している。

（4）出願人別の権利維持状況

権利の維持状況は出願人によって有意差がないかどうか超早期公開特許について調べた。図10を見ても明らかなように2011年以降の出願分については失効しているものがまだ少ないことから、2007年～2010年出願分で超早期公開数のランキング上位出願人につ

いて解析した。

最初に法人出願人と個人出願人で維持状況に差があるかどうかを見た。

その結果、図 12 に超早期公開の法人と個人の状況を比較した。無効率は個人の方が若干高かった。

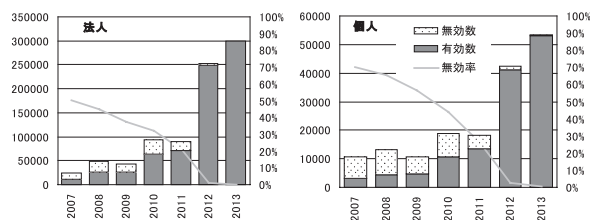


図 12 法人と個人の権利維持状況

次いで、2007 年～2010 年出願における超早期公開された出願数のランキングで上位に位置する出願人について無効率を調べ、表 2 に示した。

企業より大学、研究機関の無効率が高いことがわかった。大学の中では清華大学が他の大学に比べて無効率が低く比較的長く権利維持している様子が窺える。

表 2 超早期公開数ランキング上位出願人の無効率

出願年	2007		2008		2009		2010	
	全公開	6 か月	全公開	6 か月	全公開	6 か月	全公開	6 か月
中興通迅	22%	24%	27%	25%	16%	27%	1%	1%
中国科学院	52%	45%	45%	39%	37%	33%	30%	24%
華為技術	31%	31%	36%	33%	14%	23%	6%	16%
浙江大学	62%	63%	58%	54%	39%	40%	30%	30%
上海交通大学	65%	67%	51%	43%	31%	32%	28%	30%
友達光電	20%	18%	19%	16%	33%	16%	15%	14%
清華大学	28%	35%	30%	32%	22%	25%	17%	18%
杭州華三通信技術	18%	16%	26%	19%	16%	17%	9%	15%
北京航空航天大学	53%	58%	56%	48%	42%	49%	23%	26%
ハルビン工業大学	68%	70%	65%	63%	50%	53%	39%	40%
東南大学	50%	46%	45%	36%	32%	32%	30%	32%
天津大学	70%	74%	66%	59%	39%	49%	39%	40%

さらに個人出願人の権利維持状況を 2007 年～2010 年出願において、超早期公開された出願数の総計が 200 件以上のランキング上位の個人について公開数と

無効数から無効率を求めて検証した。結果を表 3 に示した。

個人の場合には母数が少ないために無効率として捉えるには若干問題もあるが、概して、法人に比べ無効率が高いことがわかった。

5. おわりに

最近の中国特許の出願動向として 2012 年以降の出願においては、出願から 6 か月以内に公開になるものが急激に増えているという実態がある。この超早期公開特許の急激な増加理由は 2012 年に施行された「優先審査請求制度」の影響によるものかどうか、現時点で確認できなかったが、日本特許の公開状況で代表されるような、「出願から 18 か月後に公開される」というこれまでの常識を覆すものである。

中国においては、日本や韓国と異なり、出願され公開された後でないと審査が始まらないことになっているので、公開前に登録になる特許はない。早期公開請求などで審査を促進させる制度と共に優先審査請求制度が加わり、今後は早期に登録になる特許も増えてくることになるので、早期公開特許と共に早期の登録特許の監視がますます重要となる。

特に、商用英語データベースへの中国特許の収録にはタイムラグもあることから早期に公開される、あるいは早期に登録される特許を網羅的に把握するためには中国語データベースを用いた補完が必要となる。

本報告における検証結果からは、早期公開特許、早期登録特許が通常公開特許に比べ、「重要特許であり権利維持期間も長い」という結論は導き出せなかったが、重要特許が含まれていないかどうか、さらに詳細な検討が求められる。

本稿は、2011 年度のアジア特許情報研究会のワーキング「早期公開・登録および遅延公開をめぐる東アジア各国の諸問題」を INFOPRO2011 で発表した⁽⁷⁾、その後、中国においては「優先審査請求制度」の導入

表 3 個人出願人の権利維持状況

出願年	2007			2008			2009			2010		
	公開数	無効数	無効率	公開数	無効数	無効率	公開数	無効数	無効率	公開数	無効数	無効率
王伟	21	17	81%	37	36	97%	19	11	58%	11	6	55%
王军	152	149	98%	19	15	79%	24	7	29%	36	19	53%
许庆华	12	8	67%	12	6	50%	49	17	35%	33	0	0%
林智勇				30	17	57%	47	23	49%	48	20	42%
杜志刚	25	25	100%	54	45	83%	11	8	73%	37	12	32%
张琳	18	18	100%	54	49	91%	50	42	84%	72	2	3%
王嘉兴				2	0	0%	80	69	86%	135	120	89%
许晓华	6	2	33%	14	8	57%	7	3	43%	61	46	75%

などがあり、状況が大きく変化したので、中国特許の最新情報という形でまとめた。

(参考文献)

(1) 中国特許庁専利統計

<http://www.sipo.gov.cn/tjxx/>

(2) 専利統計簡報 2013 年第 9 期：2012 年中国有効専利年度報告（特許）

<http://www.sipo.gov.cn/ghfzs/ztjbb/201310/P020131025653689932785.pdf>

(3) 特許出願の質向上のための意見書（SIPO 2013/12）

http://www.sipo.gov.cn/yw/2013/201312/t20131225_891833.html

(4) 専利審査指南（日本語訳 JETRO 2010）

http://www.jetro-pkip.org/html/ztshow_BID_201006221059.html

(5) 「発明専利出願優先審査管理弁法」（日本語訳 JETRO

2012/6）

<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20120801.pdf>

原文：中国知識産権局

http://www.sipo.gov.cn/zwgs/ling/201206/t20120621_712805.html

(6) ロイター・ワールドニュース「ZTE2012 年は 28 億円の赤字」

<http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPTJE92Q01H20130327>

(7) 吉居ら、第 8 回情報プロフェッショナルシンポジウム発表資料（2011）

<http://www.geocities.jp/patentsearch2006/INFOPRO2011earlypub.pdf>

上記参考文献の URL は、すべて 2014 年 2 月末に確認したものである。

別添表

別表 1 中国公開特許発行推移（年単位）

公開年	出願年 公開件数	2001	分割	2002	分割	2003	分割
2001 年	50364	8144	0				
2002 年	58984	23786	6	8950	0		
2003 年	77472	23929	15	32989	8	14146	0
2004 年	93944	7929	349	29724	144	42692	23
2005 年	155446	1998	905	13126	684	46650	269
2006 年	172424	869	790	1780	1306	10391	1158
2007 年	208345	577	552	1159	1118	2545	2176
2008 年	241182	325	321	695	688	1468	1409
2009 年	281006	294	289	548	535	932	884
2010 年	631668	143	137	372	364	764	732
2011 年	368434	84	83	139	139	325	325
2012 年	543296	60	60	98	97	244	244
2013 年	632585	24	24	58	58	144	143

別表 2 中国登録特許発行推移（年単位）

登録年	出願年 登録件数	2001	分割	2002	分割	2003	分割
2001 年	16937	0	0				
2002 年	20479	5	0	0	0		
2003 年	35932	1564	0	89	0	0	0
2004 年	49409	10607	3	5483	0	587	0
2005 年	51494	13135	20	13636	13	8491	1
2006 年	58369	8428	156	15109	91	16836	27
2007 年	65771	3393	382	9595	288	17264	119
2008 年	89938	2579	395	6747	562	14235	444
2009 年	128649	1874	417	4698	693	11871	1015
2010 年	129811	551	232	1488	413	4606	714
2011 年	163948	255	184	670	433	1576	654
2012 年	217525	296	212	669	436	1367	666
2013 年	219192	149	123	331	229	639	420

（原稿受領 2014. 3. 3）